

| | | | | |
|--|--|---|---|-------|
| 沖縄工業高等専門学校 | 開講年度 | 平成30年度(2018年度) | 授業科目 | 半導体工学 |
| 科目基礎情報 | | | | |
| 科目番号 | 3211 | 科目区分 | 専門 / 必修 | |
| 授業形態 | 授業 | 単位の種別と単位数 | 履修単位: 1 | |
| 開設学科 | 情報通信システム工学科 | 対象学年 | 3 | |
| 開設期 | 後期 | 週時間数 | 2 | |
| 教科書/教材 | 半導体デバイス工学—デバイスの基礎から製作技術まで (森北出版),配布資料、PPT | | | |
| 担当教員 | 藤井 知 | | | |
| 到達目標 | | | | |
| ①半導体と金属・絶縁体の基本的な物性の違いを説明できる ②半導体の種類(真性、不純物、n型、p型、元素、化合物半導体)を理解できる ③デバイス(pn接合、バイポーラトランジスタ、MOSFET)の構造と電気特性を説明できる 【V-C-4】電子や原子等の基本的性質を理解し、金属や半導体の物性の理解に役立てられる 【V-C-4】半導体の基本的性質を理解し、pn接合の特性やトランジスタの動作原理等を説明できる | | | | |
| ルーブリック | | | | |
| | 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 最低限必要な到達レベル(可) | |
| 半導体と金属・絶縁体の基本的な物性の違いを説明できる | ・半導体と金属・絶縁体の基本的な物性の違いを定量化的に説明できる | ・半導体と金属・絶縁体の基本的な物性の違いを定性的に説明できる | ・教科書を見ながら、半導体と金属・絶縁体の基本的な物性の違いを説明できる | |
| 半導体の種類(真性、不純物、n型、p型、元素、化合物半導体)を理解できる | ・半導体のエネルギー-band図を描くことができ、キャリア(電子・正孔)の動きを説明できる | ・半導体の伝導型によってエネルギー-band図を描くことができ ・半導体の結晶構造を書くことができる | ・半導体の種類を、伝導型や結晶構造、材料に分けて説明できる | |
| デバイス(pn接合、バイポーラトランジスタ、MOSFET)の構造と電気特性を説明できる | ・デバイス(pn接合、バイポーラトランジスタ、MOSFET)の電気特性を特性式を用いて説明できる | ・デバイス(pn接合、バイポーラトランジスタ、MOSFET)の動作原理を定性的に説明できる。 | ・デバイス(pn接合、バイポーラトランジスタ、MOSFET)の構造を説明できる | |
| 学科の到達目標項目との関係 | | | | |
| 教育方法等 | | | | |
| 概要 | ・半導体の原理、構造、特性を学び、PN接合、MOS接合、ショットキー接合によるバイポーラ、MOS電界効果、MES型のダイオード、トランジスタ、集積回路の各デバイスの構造と特性の基礎を理解する。 ・半導体の製造方法、装置の概要を学ぶ。授業ではモデル図、数式を用いた基礎的な学習を行う。 ・演習問題を解きながら理解度を確認する。 | | | |
| 授業の進め方・方法 | | | | |
| 注意点 | | | | |
| 授業計画 | | | | |
| | 週 | 授業内容 | 週ごとの到達目標 | |
| 後期 | 1週 | 半導体とは? 半導体の役割、半導体デバイスの歴史 | 半導体とは? 半導体の役割、半導体デバイスの歴史 | |
| | 2週 | 半導体の性質 | 金属や半導体の物性の理解に役立てられる | |
| | 3週 | 半導体のキャリア | キャリア密度、フェルミ準位、エネルギー-bandの意味を理解し、正しくかける 金属や半導体の物性の理解に役立てられる | |
| | 4週 | 半導体の電気伝導度 | キャリアの運動、電気伝導、キャリアの生成、再結合を理解し、半導体中のキャリアの流れの等を説明できる | |
| | 5週 | ダイオード | pn接合の特性やトランジスタの動作原理等を説明できる | |
| | 6週 | p n 接合 | pn接合の特性やトランジスタの動作原理等を説明できる | |
| | 7週 | 前半復習 | 金属や半導体の物性の理解し、pnダイオードをバンド図や構造図を用いて説明できる | |
| | 8週 | 後期中間試験 | | |
| 後期 | 9週 | 金属 - 半導体接触 | ショットキー接合・オーミック接合を説明できる。 | |
| | 10週 | ショットキーダイオード | ショットキーダイオードの動作原理等をバンド図を用いて説明できる | |
| | 11週 | ショットキーダイオードとバイポーラトランジスタ | ショットキーダイオードとバイポーラトランジスタを構造、エネルギー-band図、電気特性から動作原理等を説明できる | |
| | 12週 | バイポーラトランジスタ (2) | バイポーラトランジスタの動作原理等を構造、エネルギー-band図、電気特性から説明できる | |
| | 13週 | MOSデバイス(ダイオードとトランジスタ) | MOS動作である蓄積層、空乏層、反転層を説明できる。 | |
| | 14週 | 集積回路 | ゲート回路等の動作原理等を説明できる | |
| | 15週 | 半導体プロセス | 製造プロセスの学習リソグラフィ技術、蒸着技術、エッチング技術を理解する。 | |
| | 16週 | 期末試験 | | |

| 評価割合 | | | | | | | |
|---------|----|----|------|----|---------|-----|-----|
| | 試験 | 発表 | 相互評価 | 態度 | ポートフォリオ | その他 | 合計 |
| 総合評価割合 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| 基礎的能力 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 応用力 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |